

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成24年9月27日(2012.9.27)

【公表番号】特表2010-514940(P2010-514940A)

【公表日】平成22年5月6日(2010.5.6)

【年通号数】公開・登録公報2010-018

【出願番号】特願2009-544347(P2009-544347)

【国際特許分類】

C 23 C 14/34 (2006.01)

【F I】

C 23 C 14/34 S

C 23 C 14/34 P

【手続補正書】

【提出日】平成24年8月13日(2012.8.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

陰極スパッタリングにより基板(3)の平坦な基板表面(4)上に基板表面(4)における一定の公称の方向性で方向性を有する層を形成するための装置であって、少なくとも1つのターゲット(5)が置かれた真空チャンバ(10)を有し、前記基板表面(4)が前記少なくとも1つのターゲット(5)のターゲット表面(6)に向かい合うような形で前記基板(3)を取り付けるに適した少なくとも1つのホルダを含み、実質的に平坦で互いに平行な複数のプレート(9)を有する少なくとも1つのコリメータ(8)が前記ターゲット表面(6)とホルダの間に置かれた装置において、

前記プレート(9)は前記基板表面(4)に垂直な方向に整列され、プレート(9)の平均の長さは前記コリメータ(8)の中心から外側端部へ向かうにつれて減少することを特徴とする装置。

【請求項2】

前記プレート(9)の少なくとも一部の厚さは基板表面(4)に平行な方向において変化する請求項1記載の装置。

【請求項3】

前記厚さはいずれも前記プレート(9)の中心点から外側端部へ向かうにつれて減少する請求項2記載の装置。

【請求項4】

前記ホルダに対する前記コリメータ(8)の位置は、一方の位置において各プレート(9)が他方の位置においては空き状態である地点を互いに占めるような形で2つの地点間で切り換わり得る請求項1～3のいずれか1項に記載の装置。

【請求項5】

前記コリメータ(8)の一方の位置において端のプレートは例外として各プレートはいずれも他方の位置においては他のプレート(9)によって占められる2つの位置の中間にほぼ位置する場所を互いに占める請求項4記載の装置。

【請求項6】

前記コリメータ(8)は、前記基板表面(4)に対してそれへ向かう軸の回りに半回転することでそれぞれの他の位置へ移動し得る請求項4または5記載の装置。

【請求項 7】

前記プレート（9）の平均の厚さは前記コリメータ（8）の中心から外側端部へ向かうにつれて減少する請求項1～6のいずれか1項に記載の装置。

【請求項 8】

前記ホルダは前記ターゲット表面（6）に対して前記複数のプレート（9）に平行な方向に移動し得る請求項1～7のいずれか1項に記載の装置。

【請求項 9】

好ましい磁化方向を有する磁気層の製造のために請求項1～8のいずれか1項に記載の装置を使用する方法。